

Pressa Iostatica Calda Per La Ricerca Sulle Batterie Allo Stato Solido

Numero articolo: PCIH



introduzione

Scoprite l'avanzata Warm Isostatic Press (WIP) per la laminazione dei semiconduttori. Ideale per MLCC, chip ibridi ed elettronica medica. Aumenta la resistenza e la stabilità con precisione.

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
Intervallo di pressione	0-20T	0-40T	0-60,0 tonnellate	0-100 tonnellate
Diametro del pistone	130 mm (d) con cilindro dell'olio cromato	150 mm (p) con cilindro dell'olio cromato	200 mm (p) con cilindro dell'olio cromato	220 mm (d) con cilindro dell'olio cromato
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Scarico temporizzato della pressione			
Tempo di mantenimento	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti
Conversione della pressione	Il programma converte automaticamente la pressione sopportata dal campione			
Display	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici
Temperatura di riscaldamento	Temperatura ambiente-200,0C	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente-200.0C
Pressione isostatica	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
Dimensioni della camera isostatica	Φ30×150mm (M×N)	Φ40×150mm (M×N)	Φ×50×150 (M×N)	Φ×50×150 (M×N)
Corsa del pistone (T)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm